First Hit

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

Generate Collection

Print |

L14: Entry 167 of 235

File: JPAB

Mar 1, 1994

PUB-NO: JP406057383A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06057383 A

TITLE: FE-NI ALLOY THIN SHEET AND FE-NI-CO ALLOY THIN SHEET FOR SHADOW MASK

EXCELLENT IN MAGNETIC PROPERTY AND PRODUCTION THEREOF

PUBN-DATE: March 1, 1994

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

INOUE, TADASHI TSURU, KIYOSHI

OKITA, TOMOYOSHI

INT-CL (IPC): C22C 38/00; C21D 8/02; C22C 38/08; C22C 38/52; H01J 9/14; H01J 29/07

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the magnetic permeability and to reduce color slippage generated from the bias of electron beams caused by a stray magnetic field by regulating the integrating degree and hardness of the crystalline planes on the surface of the alloy sheet after being subjected to blackening treatment in which Ni, Mn, Si, Cr Ti, Mo or the like are specified.

CONSTITUTION: The alloy constituted of, by weight, 34 to 38% Ni, 0.35% or less Mn, 0.06% or less Si, 0.05% or less Cr, 0.02% or less Ti, 0.05% or less Mo, 0.05% or less W, 0.02% or less Nb, 0.05% or less V, 0.05% or less Cu and 0.25% total or less of Ti, Cr, Al, Si, Mo, W, Nb, V and Cu, and the balance Fe is melted. The hotrolled steel strip of this alloy is annealed at 810 to 890°C, and cold rolling-recrystallization annealing-finish cold rolling-stress relief annealing are executed. Next, it is subjected to annealing before press-forming at 720 to 900°C and is subjected to blackening treatment at 520 to 600°C. Then, accumulation degree and Vickers hardness of the crystalline planes of {331}, {210} and {211} on the surface after being subjected to the blackening treatment are regulated.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO&Japio

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-57383

(43)公開日 平成6年(1994)3月1日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C22C 38/0	302 R			
C21D 8/0	2 D	7412-4K		•
C 2 2 C 38/0	3			
38/5	2			
H01J 9/1	l G	7354-5E		
			審査請求 未請求	京 請求項の数4(全 15 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平5-62443		(71)出願人	000004123
				日本鋼管株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)3	月1日		東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
			(72)発明者	井上 正
(31)優先権主張番	号 特顯平4-78504			東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日
(32)優先日	平4(1992)2月28	B		本鋼管株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)		(72)発明者	4 清
				東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日
				本鋼管株式会社内
			(72)発明者	大北 智良
				東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 日
				本鋼管株式会社内
		•	(74)代理人	弁理士 白川 一一

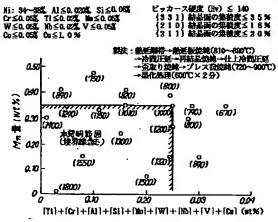
(54) 【発明の名称】 磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe−Ni合金薄板およびFe−Ni−Co合金薄板および その製造方法

(57)【要約】

【目的】 磁気特性、特に50k以上の周波数帯域での 透磁率を優れたものとし、この周波数帯域での迷走磁場 遮蔽(シールド)を充分に行い得るシャドウマスク用Fe ーNi合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板を提供する。

【構成】 Ni:30~38%, Mn≦0.35%, Si≦0.05%, Cr≦0.05%, Ti≦0.02%, No≦0.05%, W ≤0.05%, Nb≦0.02%, V≤0.05%, Cu≤0.05%, Co≦6%であって、 (Ti)+(Cr)+(Al)+(Si)+(Mo)+(W)+(Nb)+(V)+(Cu)≤0.25%を含有するFe-Ni合金およびFe-Ni-Co合金であって、黒化処理後の合金板表面への {331}、{210}、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かつビッカース硬度(Hv)が140以下である。

結晶面	集積度(%)
{331}	35以下
(210)	16以下
{211}	20以下



【特許請求の範囲】

【請求項1】 wt%で、Ni:34~38%、Mn:0.35%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、W:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下であって、(Ti)+(Cr)+(Al)+(Si)+(Mo)+(W)+(Nb)+(V)+(Cu)≤0.25%を含有し、残部不可避不純物およびFeの成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かり、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かり、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かり、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かりで、カース硬度(Hv)が140以下であることを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板。

【表1】

結晶面	集積度(%)
{331}	3 5 以下
{210}	16以下
{211}	20以下

【請求項2】 wt%で、Ni:34~38%、Mn:0.35%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、W:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Co:1.0%以下であって、「Ti]+ [Cr]+ [Al]+ [Si]+ [Mo]+ [W]+ [Nb]+ [V]+ [Cu]≤0.25%を含有し、残部不可避不純物およびFeの成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かつビッカース硬度(Hv)が140以下であることを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni-Co合金薄板。

【表2】

結晶面	集積度(%)
{331}	3 5 以下
{210}	16以下
{211}	20以下

【請求項3】 wt%で、Ni:30~38%、Mn:0.35%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、W:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Co:1.0%超え6%までであって、「Ti]+(Cr)+(Al]+(Si)+(Mo]+(W)+(Nb)+(V)+(Cu)≤0.25%を含有し、残部不可避不純物およびFeの成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集

積度が下表を満足し、かつビッカース硬度 (lw) が14 0以下であることを特徴とする磁気特性に優れたシャド ウマスク用Fe-Ni-Co合金薄板。

【表3】

結晶面	集積度(%)
{331}	3 5 以下
{210}	16以下
{211}	20以下

【請求項4】 請求項1~3に記載の成分を有する低熱 膨張合金の熱延頻帯を熱延板焼鈍して以降冷間圧延一再 結晶焼鈍一仕上冷間圧延一歪取り焼鈍を行なった後、プレス成形前の焼鈍を施し、引き続くプレス成形ののちに 黒化処理を施す工程にて製造するに際し、前記熱延板焼 鈍温度(T₀, ℃)を810~890℃、前記プレス成 形前の焼鈍温度(T₁, ℃)は720~900℃、黒化 処理温度(T₂, ℃)520~600℃で、かつ

20 【T2] ≥ - (4 [T1]/9) +920を満たすことにより、黒化処理後の合金板表面への {331}、{210}、{211}の結晶面の集積度、およびビッカース硬度(Hv)が請求項1に記載した値に調整することを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【従来の技術】近年、カラーテレビの高品位化に伴い、色ずれの問題に対処できるシャドウマスク用合金として、34~38wt%のNiを含有するFe-Ni系合金(以下「従来のFe-Ni系合金」という)が使用されている。この従来のFe-Ni系合金は、シャドウマスク用材料として従来から使用されてきた低炭素鋼に比べ、熱膨張率が著しく小さい。従って、従来のFe-Ni系合金によってシャドウマスクを作れば、シャドウマスクが電子ビームにより加熱されても、シャドウマスクの熱膨張による色ずれの問題は生じ難い。

【0003】シャドウマスク用合金薄板は、通常、下記工程によって、製造される。即ち連続鋳造法または造塊法によって、合金塊を調製し、次いで、このように調製された合金塊に、分塊圧延、熱間圧延および冷間圧延・焼鈍を施して、合金薄板を製造するものである。

の成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面 【0004】上述したように製造されたシャドウマスクへの{331}、{210}、{211}の結晶面の集 50 用合金薄板は、通常、下記工程によって、シャドウマス

3

クに加工される。即ちシャドウマスク用合金薄板に、フォトエッチングによって、電子ビームの通過孔(以下、単に「孔」という)を形成し(以下、エッチングによって穿孔されたままのシャドウマスク用合金薄板を「フラットマスク」という)、次いで、フラットマスクに焼鈍を施し、次いで、焼鈍を施したフラットマスクを、ブラウン管の形状に合うように曲面形状にプレス成形し、その後に、これをシャドウマスクに組立て、そして、その表面上に黒化処理を施すものである。

【0005】ところが、このような従来一般のFe-Ni系 10 合金をシャドウマスクに使用する場合には、カラーブラウン管の外部の環境に存在する迷走の磁場により電子ビームが偏倚し、所定の画素に当たらなくなることによる"色ずれ"がしばしば発生し、画面品質上問題となっており、この問題に対して、次の先行技術が知られている。即ち特開昭64-62421号公報は、穿孔マスク(フラットマスク)を900~1200℃で5分以上、場合により還元性雰囲気にて焼鈍し、プレス成形を93.3℃で行ない、次に、787.8℃、場合により弱酸化性雰囲気で焼鈍することにより、直流の保磁力を1エルステッド以 20下とし、上記した"色ずれ"の問題を解決しようとするものである。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記した先行技術では、地磁気といった直流の迷走磁場に対しては効果が見られたが、実際の外部の環境では、50比以上の周波数による交流での迷走磁場が多く存在し、これらの迷走磁場に対しては効果を十分に発揮することができず、その結果として、電子ビームの偏倚が依然として発生し、色ずれの問題が残っている。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記した実情に鑑み、検討を重ねて創案されたものであり、磁気特性が優れ、特に50k以上の交流の透磁率が優れ、このような周波数域の迷走磁場を十分に遮蔽(シールド)することが可能な、シャドウマスク用Fe-Ni合金およびFe-Ni-Co合金薄板およびその製造方法を提供することに成功したものであって以下の如くである。

【0008】(1) wt%で、Ni:34~38%、Mn:0.35%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、W:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下であって、「Ti)+(Cr)+(Al)+(Si)+(Mo)+(W)+(Nb)+(V)+(Cu)≦0.25%を含有し、残部不可避不輔物およびFeの成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かつビッカース硬度(Hv)が140以下であることを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板。

[0009]

【表4】

結晶面	集積度(%)
{331}	35以下
{210}	16以下
{211}	20以下

4

【00.10】(2) wt%で、Ni:34~38%、Mn:0.35%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、W:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Co:1.0%以下であって、「Ti]+(Cr]+(Al]+(Si]+(Mo)+(W)+(Nb)+(V)+(Cu)≦0.25%を含有し、残部不可避不純物およびFeの成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かつビッカース硬度(Hv)が140以下であることを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni-Co合金薄板。

[0011]

【表5】

結晶面	集積度(%)
{331}	35以下
{210}	16以下
{211}	20以下

30

【0012】(3) wt%で、Ni:30~38%、Mn:0.35%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、W:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Co:1.0%超え6%までであって、〔Ti]+〔Cr]+[Al]+[Si]+[Mo]+[W]+[Nb]+[V]+[Cu]≦0.25%を含有し、残部不可避不純物およびFeの成分組成からなり、しかも、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集積度が下表を満足し、かつビッカース硬度(Hv)が140以下であることを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni-Co合金薄板。

[0013]

【表6】

40

結晶面	集積度(%)
{331}	3 5 以下
{210}	16以下
{211}	20以下

【0014】(4)前記(1)~(3)項に記載の成分を有する低熱膨張合金の熱延頻帯を熱延板焼鈍して以降冷間圧延-再結晶焼鈍-仕上冷間圧延-歪取り焼鈍を行 10なった後、プレス成形前の焼鈍を施し、引き続くプレス成形ののちに黒化処理を施す工程にて製造するに際し、前記熱延板焼鈍温度(To, ℃)を810~890℃、前記プレス成形前の焼鈍温度(To, ℃)は720~900℃、黒化処理温度(To, ℃)520~600℃で、かつ〔To]≥-(4〔To]/9)+920を満たすことにより、黒化処理後の合金板表面への{331}、{210}、{211}の結晶面の集積度、およびビッカース硬度(Hv)が請求項1に記載した値に調整することを特徴とする磁気特性に優れたシャドウマスク 20用Fe-Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板の製造方法。

[0015]

【作用】上記したような本発明について更に説明すると、本発明者等は、既述したような観点から、磁気特性に優れたシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板を開発すべく、鋭意研究を重ねた結果、次の知見を得た。即ち、本発明はシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板の化学成分組成、ビッカース硬度、合金薄板表面への特定の結晶面の集積度30を所定の範囲内に調整することにより、所要の磁気特性を得るものである。なお本発明でいう所要の磁気特性を得るものである。なお本発明でいう所要の磁気特性をは、50比以上の周波数での透磁率のことであり、この透磁率を高めることが本発明で意図するところである。このような50比以上の透磁率の向上により、前記した周波数域の迷走磁場の連蔽(シールド)を十分に行なうことができる。

【0016】また、本発明者らは次の知見を得た。即 ち、本合金の製造工程において、熱延鋼帯を冷間圧延す る前に所定温度で熱延板焼鈍を施し、更には、プレス成 40 めた。 形前の焼鈍温度および黒化処理温度を適正にすることに より所定の黒化処理後のビッカース硬度、所定の合金薄 板表面への結晶面の集積度を得て、磁気特性を優れたも のとすることができる。

【0017】この発明は、上述したような知見に基づいてなされたものであって、本発明のシャドウマスク用Fe -Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板に関する化学成分、ビッカース硬度、および合金薄板表面への結晶面の 集積度の限定理由は以下の如くである。

【0018】(1)ニッケル:色ずれの発生を防止する 50 であり、製法については図1中に示す通りであるが、

ために、シャドウマスク用Fe-Ni合金薄板に要求される、30~100℃の温度域における平均熱膨張係数の上限値は、2.0×10-6/℃である。前記熱膨張係数は、前記合金薄板のニッケル含有量に依存する。そして、上述した平均熱膨張係数の条件を満たすニッケル含有量の範囲は、34~38wt%の範囲である。従って、ニッケル含有量は、34~38wt%の範囲内に限定すべきである。なお、このようなNi含有量の範囲内でも、平均熱膨張係数を低下させうる好ましいNi量は35~37%であり、更にはこの平均熱膨張係数をより低下させうる更に好ましいNi量は35.5~36.5%である。

【0019】なお、Coを0.001~1.0%含有する場合でも、上記した平均熱膨脹係数の上限値を満足するNi量は34~38%であり、平均熱膨脹係数を低下させる好ましいNi量は35~37%である。また、1.0%超え6%までのコバルトを含有するFe-Ni-Co合金薄板の場合、上述した平均熱膨脹係数の条件を満たすニッケル含有量の範囲は30~38%であり、また、Ni量を30~33%、Co量を3~6%にすることにより、平均熱膨脹係数は更に低く優れたものとなる。

【0020】(2)マンガン: Mは、本合金中には、熱間加工性を向上させるが、含有量が多くなると、50Hz以上の周波数での透磁率が低下する。即ち、M量が0.35%を越えると、上記した磁気特性の劣化が著しくなるので0.35%を上限とした。なお、このM量を低減することにより更に上記した磁気特性を向上しうる。

【0021】(3) アルミニウム、シリコン、クロム、チタン、モリブデン、タングステン、ニオブ、バナジウム、銅: Al、Si、Cr、Ti、Mo、W、Nb、V、Cuは、本合金中に不可避的に混入する不純物の1つである。これらの元素の含有量が多くなると、50hk以上の周波数での透磁率が低下する。即ち、上記した元素が、下記の特定値を超えると磁気特性の劣化が著しくなる。Al:0.020%、Si:0.05%、Cr:0.05%、Ti:0.02%、Mo:0.05%、W:0.05%、Nb:0.02%、V:0.05%、Cu:0.05%。従って、Al:0.020%以下、Si:0.06%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、Mo:0.05%以下、Cr:0.05%以下、Ti:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Nb:0.02%以下、V:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Cu:0.05%以下、Cu:0.05%以下とそれぞれ定

【0022】更に、本発明で意図する磁気特性を得るには、上記した元素の総和の量の規定も重要である。即ち、図1はTi、Cr、Al、Si、Mo、W、Nb、Vの各量が本発明規定範囲内で、ビッカース硬度(Hv)も本発明規定範囲内であり、{311}、{210}、{211}結晶面の集積度がそれぞれ本発明規定範囲内の合金における〔Ti〕+〔Cr〕+〔Al〕+〔Si〕+〔Mo〕+〔W〕+〔Nb〕+〔V〕+〔Cu〕量と透磁率の関係を示すものである。透磁率の測定方法は後述する実施例1に示す如くであり、製法については図1中に示す通りであるが、

(Ti) + (Cr) + (Al) + (Si) + (Mo) + (W) +(Nb) + (V) + (Cu) 量が0.25%を越えると、透磁 率の劣化が著しくなるので、0.25%を上限に定めた。 なお、これらの元素の総量が本発明範囲内であっても、 その総量を低減することにより、透磁率を更に向上する ことができる。

【0023】なお、本発明によるシャドウマスク用Fe-NiおよびFe-Ni-Co合金は、上記したようにFe-Niおよ びFe-Ni-Coの基本組成に、特定量のMn、Al、Si、Cr、 Ti、Mo、W、Nb、V、Cuとし、かつ後述するように、黒 10 化処理後の合金板表面への {331}、 {210}、 {211} の結晶面の集積度を特定値以下としかつビッ カース硬度 (Hv) を140以下とすることを特徴として いるが、前記組成の他に、C:0.0001~0.0050 %、N:0.0001~0.0020%、S:0.0001~ 0.0020%, P:0.0001~0.0050%, O:0. 0001~0.0030%以下であることが好ましい。 【0024】本発明において優れた磁気特性を得るため には、上記した成分規定に加えて黒化処理後の合金板表 面への特定の結晶面の集積度の制御およびビッカース硬 20 することができる。 さの制御が重要である。

【0025】すなわち、黒化処理後の合金板表面への {331}、{210}、{211}の各結晶面の集積 度(以下、単に、{331}結晶面の集積度、{21 0 } 結晶面の集積度、 {211} 結晶面の集積度と呼 ぶ) が、それぞれ35%、16%、20%を超えると、 上記した成分規定を満たした場合でも、所要の磁気特性 が得られない。

【0026】以上のような技術的事情より、{331} 結晶面の集積度を35%以下、{210}結晶面の集積 30 度を16%以下、{211}結晶面の集積度を20%以 下とそれぞれ定めた。

【0027】本合金においては、X線回折により、(1 11) (200) (220) (311) (33 1)、(420)および(422)の各回折面のX線回 折強度が得られ、これらにより結晶方位の集積度を測定 することができる。すなわち {331} 結晶面の集積度 は(331)回折面の相対X線強度比を(111)、 (200), (220), (311), (331),比の和で割ることにより求めた。

【0028】ここで相対X線回折強度比とは各回折面で 測定されたX線回折強度をその回折面の理論X線強度で 割ったものである。たとえば (111) の回折面の相対 X線回折強度比は(111)回折面のX線回折強度を (111)回折面のX線回折理論強度で割ったものであ る。また {210}、 {211} の各結晶面の集積度は それぞれこの結晶面と方位的に同じ(420)、(42 2) の回折面の相対 X線回折強度比を前記した (11

強度比の和で割ることにより求めている。

【0029】本発明で意図する所要の磁気特性を得るた めには、上記した、成分規定、結晶方位の制御に加え て、ビッカース硬度の制御が重要である。即ち、図2 は、成分、 {331}、 {210}、 {211} 結晶面 の集積度が本発明規定内の合金板の透磁率と合金板のビ ッカース硬度の関係を示したものである。ビッカース硬 度(Hv)が140を越えると、透磁率が低下し、本発明 で意図する所要の磁気特性が得られない。以上より本発 明においては黒化処理後のビッカース硬度(Hv)を14 O以下と定めた。なおHvが140以下の場合でも、Hvを より低くすることにより、合金板の透磁率をより高いレ ベルとすることができる。

【0030】以上説明したように、本発明合金のM、A 1, Si, Cr, Ti, Mo, W, Nb, V, Cu, (Ti) + (Cr)+ (A1) + (Si) + (Mo) + (W) + (Nb) + (V) +[Cu] の規定、黒化処理後の {331}、 {210}、 {211} 結晶面の集積度の規定およびビッカース硬度 の規定により本発明で意図する磁気特性を優れたものと

【0031】黒化処理後の{331}、{210}、 {211} 結晶面の集積度をそれぞれ35%以下、16 %以下、20%以下とするためには、合金薄板の製造に かかる凝固から熱間での加工、以降の冷間圧延・焼鈍工 程で極力、 {331}、 {210}、 {211} 結晶面 を集積させない製造条件を採ることにより達成される。 例えば、本合金が、造塊または連続鋳造スラブを分塊圧 延し、熱間圧延することにより得た熱延鋼帯により製造 する場合は熱延鋼帯を素材として、以降熱延板焼鈍ー冷 間圧延-再結晶焼鈍-仕上冷間圧延-歪取り焼鈍を行 い、その後プレス成形前の焼鈍を施し、プレス成形の後 に黒化処理を施す工程で製造するに際し、先ず、熱間圧 延後で適正な熱延板焼鈍を施すことが、 {331}、 {210}、{211}結晶面を集積させないためには 有効であり、この際熱延板焼鈍の温度は、810~89 .0℃の範囲内で適切な温度を選択することにより (33 1 } 、 {210} 、 {211} 結晶面の集積度をそれぞ れ本発明規定値以下とすることができる。以上より、 {331}、{210}、{211}結晶面の集積度を (420)および(422)の各回折面の相対X線強度 40 本発明範囲内とするための熱延板焼鈍条件として810 ~890℃を定めた。

【0032】なお本発明でのこのような熱延板焼鈍は本 合金の熱延顕帯が熱延板焼鈍前で充分に再結晶している ときに発揮されるものである。また本発明で意図する {331}、{210}、{211}結晶面の集積度を 得るには本合金を製造するに当って分塊圧延後のスラブ 均一化熱処理は好ましくない。たとえば上記の均一化熱 処理が1200℃以上、10時間以上の条件で行われる 場合、{331}、{210}、{211}、結晶面の 1)から(422)までの7個の回折面の相対X線回折 50 集積度が本発明の規定値を超えてしまうので、このよう

な処理は避けねばならない。

【0033】また、上記した熱延鋼帯により製造する場 合は、前記の一連の工程の中でプレス前焼鈍条件と黒化 処理条件の適正化も (331)、 (210)、 (21 1 計 結晶面の集積度をそれぞれ本発明規定値以下とし、 更には、黒化処理後のビッカース硬度を本発明規定内と するために必要である。

【0034】図3は、本発明による合金の熱延頻帯を該 図の上部に示したような製法によって作製した合金板の 透磁率を、プレス前焼鈍温度 (T1, ℃) および黒化処 10 理温度(T₂, ℃)を変化させて調査検討した結果を示 すものである。即ちこの図3より、T1:720~90 0°C、T2:520~600°Cで、かつ(T2)≧-(4(T1)/9)+920とすることにより、{33 1 } 、 {210} 、 {211} 結晶面の集積度がそれぞ れ35%以下、16%以下、20%以下で、ビッカース 硬度 (Hv) も140以下で50比での透磁率が1000 以上と所要の磁気特性が得られている。

【0035】一方、T1が900℃を超える場合、{3 31 / 、 {210 / 、 {211 } 結晶面の集積度のうち 20 1つ以上が本発明規定を超え、透磁率が本発明で意図す るレベルを下まわる。また、T1が720℃未満かつま たは〔T₂ 〕<- (4 [T₁]/9)+920の場合 は、ビッカース硬度 (Hv) が140を超え、透磁率が本 発明で意図するレベルを下まわる。更にはT2 が600 ℃を超える場合、黒化膜の密着性が劣化する。

【0036】以上のような検討により、黒化処理後の {331}、{210}、{211}結晶面の集積度を それぞれ35%以下、16%以下、20%以下としかつ ビッカース硬度(Hv)を140以下とし、所要の磁気特 30 あった。 性を優れたものとする条件として、T1:720~90 0%, $T_2:520\sim600\%$, $(T_2) \ge -(4)(T_2)$ 1)/9)+920を定めた。なお黒化処理時間は2mi

n 以上、10min 未満であれば、本発明で意図する効果 は、上記したT1 , T2 の本発明範囲内制御のもとで達 成される。プレス前焼鈍時間は20min 以上60min 未 満であれば本発明で意図する効果は上記したTi, Tz の本発明範囲内への制御の下で達成される。

10

【0037】なお、黒化処理後の本合金薄板で {33 1 } 、 {210} 、 {211} 結晶面の集積度を本発明 規定内とする方法は、上記した以外に食冷凝固法の採 用、熱間加工での再結晶のコントロールによる集合組織 制御等がある。また、黒化処理後のビッカース硬度を本 発明規定内とする方法も上記した以外に冷間圧延条件、 焼鈍条件を適正に組み合わせることによっても達成しう

【0038】上記したように本発明では、磁気特性の向 上が主な目的であるが、黒化処理時の黒化膜の密着性を 優れたものとすることも、本発明における構成要件の1 つである。また上記した図3は、50比での透磁率につ いてのものであるが、それを超える周波数域での透磁率 についてもT1, T2 が上記したような本発明規定条件 内であれば、優れたレベルを示す。

【0039】更に、本発明におけるプレス成形前の焼鈍 は、フォトエッチングの前に実施されてもよい。この場 合、プレス成形前の焼鈍条件が本発明規定内であれば、 所要のフォトエッチングの品質は確保しうる。

【0040】上記した本発明を具体的実施例によって、 更に詳しく説明すると、以下の如くである。

〔実施例1〕取鍋精錬によって、次の表2~表4に示す 化学成分を有するNo.1~No.26 からなる鋼塊をそれぞれ 調整した。なお、いずれの合金のH量は1.0pp■ 以下で

[0041] 【表7】

	[T1]+[Cr] +[A1]+[S1] +[Ma]+[W] +[Nb]+[V] +[Cu]	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	200000000 8487858778	0.25 0.03 0.01 0.11
	8	0,01 0,102 0,10	1.85 1.82 1.82 1.82 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83	0.700 0.020 0.150 - 3.1
	ng	0.02 22 1 1 1 22 1 8	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000	0.0.0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
	Λ	0.02 1 2 2 2 2 1 1 0.07	0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09	0.03 0.005 0.005 0.0015 0.004
(wt%)	NP	0.0106 2 2 2 1 1 0.04 1	0,02 0,065 0,065 0,010 0,010 0,010 0,02	000000 000000 00000 00000 00000 00000
42 (¥	M	0.02 122 122 123 123 133 133 133 133 133 13	0.000 0.000	200000 220000 2200000
松	Жо	0. 80.4007-009	00000000000000000000000000000000000000	000000 000000 000000000000000000000000
充	II	0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00000000000000000000000000000000000000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
	ď	20 0 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	558558585 55555555	000000 898988 89888 5088
		0. 0. 0.0000000000000000000000000000000	000000000 88489889898 8848989898	000000 8 2 888 88288
	Ψ	9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	000000000000000000000000000000000000000	000000 0000000000000000000000000000000
	¥	4885255888	ರರರರರರರ ಜನಜಜಜಾಬ್ರಾಬ್ಗಳ	000000 000000 000000
	ž	张宏宏张张宪张张张 下 ***	ង្គង្គង្គង្គង្គង្គង្គង្គ -	88888 189
4	No.	~ഗര 4 നന-ജമ ്	2224684868	ដ្ឋមន្ត្រ
7	. Ус.	~400400C	======================================	ដ្ឋមន្ត្រ

[0042]

1	~

3							1 -
材料	合金	1	と 学	成分	(wt %)		
77144	12 MZ	С	N	0	S	P	
No.	No.						
1	1	0.0055	0.0015	0.0020	0.0019	0.002	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	40	20	18 35	16	3	١
J A	J A	32 36	16 13	35 28	17	3 4 3 5 4 3 3	l
5	5	34	13	24	22 20 12 12 16	5	l
6	6	30	15	24 27	12	4	l
7	7	42	12 13	24	12	3	l
8	8	31	13	25	16	3	l
10	10	36 40	14 15	24 25 25 19	11 14	,4 ,4	
11 12 13 14 15 16 13 18 19	11	0.0024	0.0011	0.0018	0.0020	0.05	l
12	12 13	42 33	18 14	20	19 20	5	l
14	13	25	15	29 30 15 07 18 23 21 02	14	5 2 2 4 0.003 2 2 1	
15	15	47	12 06 03	07	11	4	l
16,	16	21	06	18	08	0.003	
UZ	15 16 17 18 19	17	03	25	14	2	l
10	10 10	19 13	07 01	23	12	1	l
20	20	08	02	02	08 14 12 05 03	l i	l
						_	
21 22 23 24 25 26	21	0.0050	0.0015	0. 0017	0.0010	4	
22	22	48	16	27	15 18	<0.001	1
23 21	ដ ស្តស្តស្ត	48 32 02	10 0 1	08 01	01	0. 005 0. 0002	
25	25	18	15	21	07	0.0002	
26	26	16	11	24	06	0.001	

[0043]

* *【表9】

				• -	•				1,72.3	
15			······································				16			
材料	ピッ: 合金 ース		結晶面の集積度(%)			透磁率(μ)			<i>u</i>)	
		硬度	(331)	(210)	[211]	50Hz	0. 3KHz	3KHz	30KHz	
No.	No.	(lłv)	結晶面	枯晶面	結晶面					
1	1	135	22 25	4	16	820	810	710	250	
23 4 56 789	2	132	25	7	14	870	860	720	260	
3	3	126	21	5 15	12	800	800	670	260	
4	4	137	33	15	- 19	810	800	680	260	
5	5 6 7 8 9	129	16	4 9	13	890	880	750	270	
0 7	9	132 128	17	2	12	850 900	840 880 870	710 740	260 290 260 280	
اما	á	120	15 25 30) i	11 16	890	970	760	220 260	
اقا	ğ	133 135	30	7	18	900	870	740	280	
10	10	137	17	4 2 3 6 7 4	ii	890	870	750	250	
					**		0.0			
11	11	139	30	9	19	800	800	650	260	
12	12	144	30	11	16	600	590	520	280	
13	13	140	37	16	20	880	860	740	260	
14	14	131	35	21	20	870	870	720	260	
15	15	128	32	11	22	890	860	760	260	
16	16	140	33	l ië	18	1010	990	900	350	
17	17	136	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	16 5 3 10 2	17 12	1500	1490 1280	1350 1100	420 410	
18 19	18 19	138 139	70	10	17	1300 1150	1130	980	400	
20	20	125	15	10	10	1800	1780	1600	440	
<i>ω</i>	ω	160	10	'	10	1000	1100	1000	VET.	
21	21	140	29	8	20	1000	980	890	340	
22	22	139	22	4	13	1200	1180	1000	380	
23	23	134	29 22 23	6	15	1550	1540	1490	430	
24	24	137	16	′ 3	11	1400	1390	1200	430	
25	25	138	32 30	8 4 6 3 15 16	17	1000	980	900	340	
26	26	134	30	16	18	1020	990	910	360	
					•					

【0044】上記のようにして得られたインゴットの各 加熱は1100℃×3時間)、疵取りして得られた熱延 コイルを用いて次の表5に示す条件にて、熱延板焼鈍を 行なった。以降、冷延一焼鈍一仕上げ冷間圧延一歪取り*

*焼鈍を行ない、板厚0.25mmの合金板を得た(合金No.1 々を手入れ後、分塊圧延、表面疵取り、熱間圧延(熱延 30 ~26はそれぞれ材料No.1~26と以下称する)。なお、こ れらの合金は熱間圧延後で十分再結晶していた。

[0045]

【表10】.

P. DE MAR ELLOTHALISE LEWY							
合金Na	焼鈍温度 (℃)	合金No	焼鈍温度 (℃)	合金Na	焼鈍温度 (℃)		
		24. 5.	840	21.11.	890		
14.	800	20. 6, 7,	850	15,	900		
16. 4. 25. 26	810	18, 10,	860	13,	920		
19, 12, 9	820	22. 3.	870				
23, 1, 2,	830	17, 8,	880				

【0046】これらの材料を、エッチングによりフラットマスクにした後、このフラットマスクを860℃×20min にプレス成形前の焼鈍を行ないプレス成形ののち、600℃×2分の条件にて黒化処理を行なった。黒化処理後の合金板の表面の{331}、{210}、

化処理後の合金板の表面の {331}、 {210}、 {211} 結晶面の集積度は前記した X 線回折による方法により求めた結果を前記表 4 に示した。また、黒化膜の密着性は黒化膜の上にテープをはり、180°密着曲げをしてから、テープを剥がし、テープ上への黒化膜の付着がないものを黒化膜の密着性が良好、テープへの黒化膜の付着があるものを黒化膜の密着性が不良とそれぞれ定めた。 【0047】この実施例における材料No.1~No.26 の各材の黒化膜の密着性はいずれも良好であった。本発明では、このように黒化膜の密着性が優れていることが重要な構成要件の1つである。

【0048】なお、前記した、プレス成形前の焼鈍、引き続くプレス成形、および黒化処理を経た合金板(材料No.1~No.26)より、リング試験片を加工し、50Hz、0.3 KHz、3 KHzおよび30 KHzでの交流透磁率も調べた。印加した磁界は5 mエルステッドである。またこれらの合金板についての黒化処理後のビッカース硬度(Hv)は合金板の断面で測定し、その結果は併せて前記表10に示した。

【0049】前述した表7~表9に示した結果から明らかなように、本発明範囲内の成分組成、ビッカース硬度(Hv)を有し、かつ本発明の範囲内の{331}、{210}、{211}結晶面の集積度を有する材料No.16~No.26の50Hz以上の透磁率は後述する比較例に比べて高く、優れたレベルを示している。また、材料No.17、No.18、No.20、No.23、No.24、No.25、No.26は本発明例の中でもHvがより好ましいレベルまで低減されたものであり、No.17、No.18、No.20、No.23、N *

*0.24 の5 OHz以上の透磁率は、より高い値を示している。更には、これらの材料の中でも、材料No.20 は、Mn、A1、Si、Cr、Ti、Mo、W、Nb、V、Cu、および〔Ti]+[Cr]+[A1]+[Si]+[Mo]+[W]+[Nb]+[V]+[Cu]量がより好ましいレベルまで低減されたものであり、5 OHz以上の透磁率はより高い値を示している。Coを含有する材料No.25、No.26 も同様に優れた特性を示している。

18

【0051】また、材料No.12~No.15 はそれぞれ、本発明の範囲外のビッカース硬度(Hv)、{331}結晶面の集積度、{210}結晶面の集積度、{211}結晶面の集積度のものであり、いずれも50Hz以上の透磁率は本発明例に比べて劣っている。

20 【0052】上記したところから明らかなように、本発明範囲内の成分組成および本発明範囲内におけるビッカース硬度(Hv)、{331}、{210}、{211} 結晶面の集積度とすることにより、50Hz以上の透磁率が優れたレベルを有するシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄板が得られることがわかる。【0053】(実施例2)前記した実施例1で用いた合金No.16~No.22、25、26の熱延顕帯を用いて、以降、熱延板焼鈍を次の表6に示す条件にて実施したものについて、以降、冷間圧延一再結晶焼鈍一仕上げ冷間圧延一至取り焼鈍を行ない、板厚0.25 ■の合金板を得た。【0054】

【表11】

材料№ 焼鈍温度 材料Na 焼鈍温度 材料Ma 焼鈍温度 (°C) (T) (T) 16, 25, 26, 810 18. 21. 860 890 19. 820 22. 870 20. 850 17. 880

【0055】上記した表6に示すような各合金板に、次の表7に示すような条件によってプレス成形前の焼鈍を行い引続くエッチングによりフラットマスクにした後、このフラットマスクをプレス成形し、黒化処理を施し表7,表8に示すような材料No.25~43を得た。又これらの材料を用い実施例1におけると同じ方法で黒化膜の密※50

※着性を調査した。更にこの黒化膜の密着性と共に黒化処理後の透磁率およびビッカース硬度(Hv)も前記実施例1と同じ方法で調べ、それらの結果を表8において示した。

[0056]

【表12】

1 :	9		(11)		20	
材料	合金	プレス	前焼鈍	黑化処理		
No.	No.	温度(1, ℃)	時間(min)	温度(T₂, ℃)	時間(min)	
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 	19 18 20 20 20 22	720 760 810 860 900	50 40 20 20 20	600 595 595 600 600	593258	
ਤ ਜ਼ੁਲਲੜਲਲ ਜ਼ੁਲਲੜਲਲ ਜ਼ੁਲਲੜਲ	22 16 18 23 27 21 7, 21 18 16 22	810 860 900 890 860 700 810 910 920 900 760	50 20 20 20 30 30 30 40 50 50	560 540 520 560 570 600 620 540 560 500 560	8 8359955999	
41 42 43	22 25 26	810 860 860	20 20 20	540 540 540	9 8 8	

[0057]

*【表13】

21				22
黒化膜の 密着性		000000	00000×0000	000
透磁率(μ)	30KHz	420 440 430 440 410	420 410 410 410 530 530 530 530 530 530 530 530 530 53	210 410 420
	3XHz	880 1250 1550 1600 1600 1600	1550 1550 1488 1488 1480 1480 1480 1480 1480 148	360 900 910
	0. 3Hz	1040 1380 1690 1780 1700 1200	1020 1180 1590 1540 1540 880 880 490	380 1010 1010
	50Hz	1100 1400 1700 1800 1710 1250	1030 11240 11550 1550 1550 1550 1550 1550	400 1020 1030
	{2 1 1} 結晶面	20 18 10 17	11 22 24 9 9 8 8 2 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	14 18 18
結晶面の巣髄度(%)	(210) 結晶面	∞∞ <i>∾∾</i> ∞		3 16 17
	理閏	24 14 13 15 21 18	888888888	28.21
ビッカース 硬度 (Hv)		138 131 131 125 121 132 133	140 133 131 145 128 127 143 143	146 139 137
合 (%)		998888	8288271133888	888
初格 No.		នននងន	28828882883	42 43

【0058】前記した表13に示した結果から明らかな 40*6 は黒化処理温度が本発明規定上限を超えるものであ ように、本発明範囲内の成分組成、ビッカース硬度(H v) 、 {331} 、 {210} 、 {211} 結晶面の集 積度を有する材料No.25 ~No.34 およびNo.42 、No.43 の50 世以上の透磁率は後述する比較例に比べて、高 く、優れたレベルを示している。

【0059】これに対して、材料No.35 およびNo.39 は それぞれ本発明規定の上限を超えるプレス成形前の焼鈍 温度、黒化処理温度の場合のものであるが、ビッカース 硬度(Hv)が本発明規定を越えており、50Hz以上の透 り、黒化膜の密着性が劣っている。

【0060】材料No.39 は、本発明規定未満の黒化処理 温度の場合のもの、また材料No.40~No.41 はいずれも (T₂)≥-(4(T₁)/9)+920を満たさない ものであり、黒化処理後のビッカース硬度(Hv)は本発 明規定値を超えており、50Hz以上での透磁率は、本発 明例に比べて明らかに低い。更に、材料No.37~No.38 はプレス前焼鈍温度が本発明規定の上限を超えるもので あり、{331}、{210}、{211}結晶面の集 磁率は、本発明例に比べて劣っている。また、材料10.3 * 50 積度のうち1つ以上が本発明規定の上限を超えるもので あり、50k以上の透磁率は本発明例に比べて明らかに 低い。

【0061】以上のように、ビッカース硬度(Hv)、 {331}、{210}、{211}結晶面の集積度を 本発明範囲として、かつ黒化膜の密着性を優れたレベル とするためには、プレス前焼鈍温度、黒化処理条件(温度、時間)を本発明範囲内とすることが重要であること が理解される。

[0062]

【発明の効果】以上説明したような本発明によるときは、磁気特性に優れ、特に50比以上の周波数帯域での透磁率を優れたものとし、このことより前記した周波数帯域での迷走磁場遮蔽(シールド)を充分に行い得るシャドウマスク用Fe-Ni合金薄板およびFe-Ni-Co合金薄

板を提供することを可能とし、その効果として前記迷走 磁場によりもたらされる電子ビームの偏倚から生ずる色 ずれを低減せしめるなどの好ましい結果を得しめるな ど、工業的にその効果の大きい発明である。

24

【図面の簡単な説明】

【図1】透磁率とMn量、 (Ti) + (Cr) + (Al) + (Si) + (Mo) + (W) + (Nb) + (V) + (Cu) 量の関係 (括弧内は50Hzでの透磁率の値を示す)を要約して示した図表である。

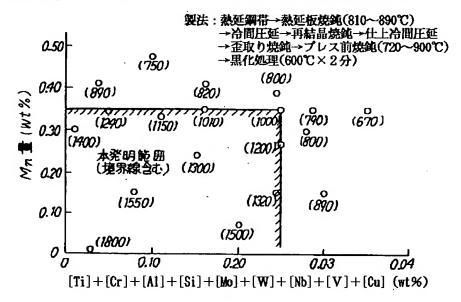
10 【図2】透磁率とビッカース硬度 (Hv) の関係を示した 図表である。

【図3】透磁率と黒化処理温度およびプレス前焼鈍温度 の関係を要約して示した図表である。

【図1】

Ni: $34\sim38\%$, A1 \leq 0. 020%, Si \leq 0. 06% Cr \leq 0. 05%, Ti \leq 0. 02%, Mo \leq 0. 05% W \leq 0. 05%, Nb \leq 0. 02%, V \leq 0. 05% Cu \leq 0. 05% Co \leq 1. 0 %

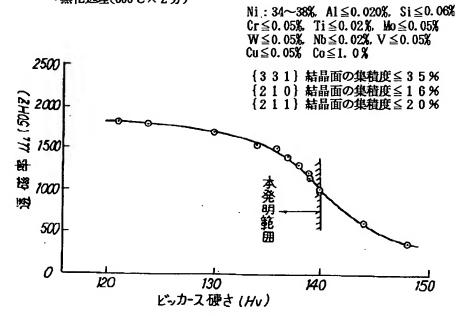
ビッカース硬度 (Hv) ≦ 140 {331} 結晶面の集積度≦35% {210} 結晶面の集積度≦16% {211} 結晶面の集積度≤20%



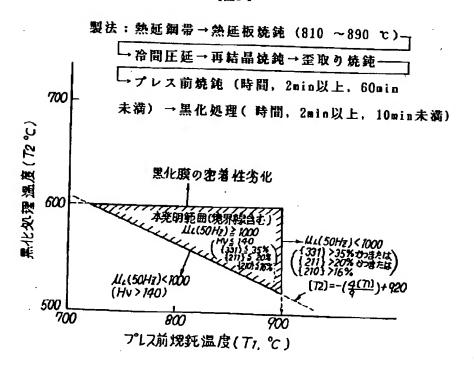
【図2】

製法: 熱延網帯→熱延板焼鈍(810~890℃)

- →冷間圧延→再結晶焼鈍→仕上冷間圧延
- → 歪取り焼鈍→プレス前焼鈍(720~900°C) → 黒化処理(600°C×2分)



【図3】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

HO1J 29/07

Z